# 周期双晶構造を有する四ホウ酸リチウムの 作製と波長変換素子への応用

# 前田健作\*

shinshinkiei

# 1. はじめに

双晶とは2つの結晶粒が対称関係をもって接合したもの であり,接合面である双晶界面はランダムな方位関係の結晶 粒界よりも低い界面エネルギーを持つ.多結晶組織中に多く 観察されるが単結晶成長時に形成されることもある.単結晶 を用いてデバイスを作製する際に双晶が存在すると特性に悪 影響を及ぼすので双晶を含まない単結晶が高品質とされ,双 晶形成を抑制する成長技術の開発が進められてきた.本研究 の特徴は、この双晶形成を敢えて積極的に利用して周期的に 結晶方位を反転させた周期双晶を作製することであり、非線 形光学結晶の周期双晶を作製することでレーザー光の波長変 換素子として利用することができる.

次世代の半導体リソグラフィーやレーザー加工の微細化に 対応するために真空紫外(波長 200 nm 以下)レーザー光源の 開発が求められている.この光源として,非線形光学結晶を 用いて固体レーザー光を第二次高調波発生(Second Harmonic Generation)により短波長化できれば,光源にガスを用い るエキシマレーザーよりも安定かつメンテンス負担の小さ い,全固体真空紫外レーザー光源が実現できる.しかし,波 長変換に用いる非線形光学結晶は真空紫外光を透過する必要 があり,この波長領域に用いられる非線形光学結晶として, CsLiB<sub>6</sub>O<sub>10</sub>(CLBO)や BaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>(BBO), KBe<sub>2</sub>BO<sub>3</sub>F<sub>2</sub>(KBBF) などのホウ酸塩結晶が知られている<sup>(1)-(3)</sup>.

一般的に結晶材料には屈折率の波長分散があるため入射光 と変換光の速さが異なり、強い強度の変換光を得るには光路 上の各地点で発生する変換光の位相を整合させる必要があ る.この方法の1つとして、非線形光学結晶の極性を周期 反転し、変換光の振幅を繰り返し反転することで位相整合さ せる,擬似位相整合(Quasi-Phase-Matching)がある<sup>(4)</sup>.擬 似位相整合では,材料の持つ任意成分の非線形光学定数を利 用することができ、反転周期を調整することで任意の波長で 位相整合が可能である.実用化されている擬似位相整合結晶 は、LiNbO<sub>3</sub>(LN)やLiTaO<sub>3</sub>(LT)などの強誘電体の酸化物結 晶に外部電界を印加して自発分極を周期的に反転させること で作製されている(5)(6).しかし、これらの強誘電体の酸化物 結晶は真空紫外光を吸収するので、真空紫外レーザー光源に は利用できない. また, 前述したホウ酸塩結晶は非強誘電体 のため電界印加では反転構造を作製できない.水晶も同じく 非強誘電体であるが、応力を印加することにより双晶形成を 制御することができる.水晶に応力を印加して周期双晶を作 製し擬似位相整合構造として利用できることが報告されてお り(7), 電界印加法と同じく均質な単結晶を材料に外場を印加 して周期反転構造を作り込んでいる. これらの外場を印加す る方法では、結晶の厚みが増すほど微細な加工が困難にな



\* 東北大学助教;大学院工学研究科知能デバイス材料学専攻(〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-11-1021)
Fabrication of Periodically-twinned Lithium Tetraborate and Application to Wavelength Conversion Devices; Kensaku Maeda(Department of Materials Science, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai)
Keywords: *nonlinear optical crystal, crystal growth, borate crystal, twin boundary, structure control, wavelength conversion* 2015年 6 月29日受理[doi:10.2320/materia.54.633]

る.また,応力印加による双晶制御の可否は結晶の持つ対称 性によるので,ホウ酸塩結晶に応用できるとは限らない.

そこで本稿では、ホウ酸塩結晶の1つである四ホウ酸リ チウムに着目し、外場印加の代わりに結晶成長過程に形成さ れる双晶を利用して図1に示す周期双晶を作製する.また、 これを利用した擬似位相整合による波長変換素子への応用に ついて報告する.

### 2. 四ホウ酸リチウム(Li<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>)の特徴

四ホウ酸リチウムは正方晶系に属するホウ酸塩結晶である (点群 4 mm, a = b = 0.95, c = 1.03 nm)<sup>(8)</sup>. 融点は 1187 K で あり, 化学量論組成と調和融解組成は一致するのでチョクラ ルスキー法などの融液成長法を用いて大型の単結晶が成長さ れている<sup>(9)</sup>. 他のホウ酸塩結晶と同じく優れた非線形光学定 数( $d_{33} = 0.93$  pm/V)<sup>(10)</sup>と広い透過波長領域(波長 170–3500 nm)<sup>(11)</sup>を合わせ持ち, 複屈折位相整合による波長 266 nm の第 2 次高調波発生が報告されているが<sup>(9)</sup>, 非強誘電体で あるため擬似位相整合構造は作製できないと考えられてきた.

四ホウ酸リチウムの双晶として, c軸を反転させた方位関 係の結晶粒が{100}または{112}を双晶界面として接合した ものが報告されている<sup>(12)(13)</sup>.本研究では, {112}双晶界面 の形成を抑えて(100)と(010)双晶界面のどちらか一方を選 択的に形成させることで周期双晶を作製する方法について考 察する.四ホウ酸リチウムは c 軸周りの四回対称性を有し (100)と(010)は等価な結晶方位であるが,本稿では便宜的 に種子結晶中の双晶界面を(010)双晶界面と呼ぶ.(010)と (100)を入れ替えても同様の考察が可能である.

#### 3. 融液成長時に形成される双晶界面

四ホウ酸リチウムの融液成長における結晶成長方位と双晶 界面の関係を調査した(14).マイクロ引き下げ法を用いて, 双晶結晶が一方向に融液成長した際に形成される双晶界面を 観察した.四ホウ酸リチウム粉末原料を充填した白金坩堝に 電流を流して抵抗加熱により原料を融解する. 坩堝底面に設 置した直径3mmのノズルから融液を引き出すことができ る. 双晶結晶を種子結晶として、下方からノズル中の融液に 接触させた後に引き下げることで結晶成長させた. 双晶結晶 は,成長方向が[100]となる方位から25°,45°,65°傾斜して 用いた.図2に示す通り、傾斜角度25°の場合は種子結晶中 の双晶界面と同じ(010)双晶界面が形成され、傾斜角度65° の場合は(010)と直角な方位関係の(100)双晶界面が形成さ れた. 傾斜角度 45°の場合は(010)と(100) 双晶界面が交互に 形成された. (010)と(100)は等価な双晶界面であるが,結 晶成長方位との相対的な角度は異なる.種子結晶を25°傾斜 させた場合は結晶成長界面と(010)双晶界面のなす角は65° であるのに対し(100)双晶界面は25°であるため,成長した 結晶中に形成される双晶界面の面積に大小関係が生じる. つ まり、成長した結晶中に(100)双晶界面を形成するよりも



図2 成長した結晶中に形成された双晶界面.結晶成長 方位は[100]から (a) 25°, (b) 45°, (c) 65°傾斜.

(010) 双晶界面を形成する方が面積は小さく,結晶成長時に 必要なエネルギーも小さくなるので(010) 双晶界面が形成さ れる.同様の考察は傾斜角度が 45°未満の場合に成立するが, 45°より大きい場合は反対に(100) 双晶界面が形成される. 図 2 では 65°傾斜の場合は(100) 双晶界面が形成され, 45°傾 斜の場合は(010) と(100) 双晶界面が交互に形成された.

#### 4. 双晶界面の制御方法

四ホウ酸リチウムの(100)双晶界面と(010)双晶界面は互いに直角で等価な界面である.結晶成長時にどちらの双晶界 面が形成されるかは,固液界面に依存する.この特徴を応用 して双晶界面を制御する方法<sup>(15)</sup>を紹介する.

図3(a)に示すような(010)双晶界面を有する板状結晶を 用意する. 一方の結晶粒の上面は c<sup>+</sup>, 他方は c<sup>-</sup> である. こ の板状結晶に垂直に白金線ヒーターを貫通させ、ヒーター周 囲の結晶を融解する. ヒーターを十分にゆっくり移動するこ とで、融液部分は円形に保たれながら、結晶は融解および成 長する.ここで図3(b)-(d)のように、融液部分をc+結晶か らc-結晶側へ移動させることで、c-結晶側にc+結晶が形 成される.結晶成長時の固液界面はヒーターを中心とした円 弧状であり、双晶界面が形成される地点での固液界面の面方 位はヒーターの移動に伴って変化する. 始めに結晶中に存在 した(010) 双晶界面の近くでは(010) 双晶界面が継続して形 成される. ヒーターの移動に伴って双晶界面が形成される地 点での固液界面の面方位が徐々に傾斜して45°に到達するま で(010)双晶界面が形成される(図3(c)).しかし、固液界面 が45°以上傾斜して成長すると(100)双晶界面が形成される ため,図3(d)に示すようにc-結晶側に2つの(100)双晶界 面と c<sup>+</sup> 結晶が形成される.

#### 5. 周期双晶の作製

前節の操作を繰り返すことで周期双晶を作製することがで きる.図4はc<sup>-</sup>結晶中にc<sup>+</sup>結晶を繰り返し形成させて作



図3 双晶界面の制御方法.

製した周期双晶である.板状結晶の表面には白金線ヒーター が通過した痕跡が残る(図4(a))が,表面を研磨した後にグ リセリン水溶液でエッチングすることで双晶形成を確認する ことができる.このとき, c<sup>+</sup>結晶の幅は双晶形成時の融液 の径に比例する.c<sup>+</sup>結晶の幅が 100 μm となるように融液 の径を調整した.200 μm 間隔で繰り返し c<sup>+</sup>結晶を形成さ せることで,100 μm 幅の周期構造を実現できる.本研究で は,径 100 μm の白金線ヒーターを用い,融液の径を直接観 察しながら一定に保つようにヒーター出力を調整した.また, 1 μm ステップの XY 軸自動ステージを用いて白金線ヒータ ーを移動させた.図4(b)に示すように c<sup>+</sup>結晶の幅にバラツ キがあるが,双晶形成時の熱の揺らぎにより融液の径が変動 することに起因する.これに対して,反転周期はヒーターの 移動量により制御することができる.

図4に示す周期双晶は板状であり、厚さは300 µm であ



34 四ホワ酸リテワムの周期双面.(a) 美体頭傾鏡 像.(b) 研磨およびエッチングした後の反射顕微 鏡像.



図5 種子結晶から成長させた周期双晶.

る.第二次高調波発生させる際には双晶界面に垂直にレーザ ー光を入射するので,板状結晶では入射レーザー光の径を大 きくすることができない.そこで,板状の周期双晶を種子結 晶として用いてマイクロ引き下げ法により一方向成長させ, バルク周期双晶を作製した.図4に示す周期双晶中には (100)周期双晶が形成されており,[010]方向へ一方向成長 させると(100)双晶界面が形成される.結果として,成長し た結晶中には種子結晶と同じ間隔の周期双晶が形成される. 図4の板状周期双晶を種子結晶として用いて,径3mm長 さ15mmのバルク周期結晶を成長させ,波長変換素子とし て用いるために図5のように表面を研磨した.この幅が2 mmのバルク結晶中には100 µm間隔の周期双晶が形成され ている.成長する結晶の大きさは結晶成長装置に依存し,坩 堝やノズルのサイズを大きくすることで,より大きな周期双 晶の成長が可能と考えられる.

#### 6. 第二次高調波発生

四ホウ酸リチウムの屈折率の波長分散<sup>(11)</sup>より,擬似位相 整合させるために必要な反転周期を算出することができる. 波長 1064 nm のレーザー光を入射して波長 532 nm へ波長 変換する場合,20 µm 間隔の周期双晶が必要であるが,100 µm 間隔の周期双晶は5次の擬似位相整合構造として機能す ると考えられる.そこで図6の光学系により第二次高調波発 生させた.光源にはQスイッチNd:YAGレーザー(波長



1064 nm, パルス幅 6 ns)を用い, 偏光方向は周期双晶の c 軸方向に一致させ, 径 2 mm のレーザー光を周期双晶に入射 した.検出器を用いて,入射光と変換光の強度を測定した (図7).130 mJ/pulse のレーザー光を入射した時に,3.8 µJ/pulse の変換光が得られた.この時,入射光の強度は 0.7 GW/cm<sup>2</sup>であるが,四ホウ酸リチウムのダメージ閾値は, 5.5 GW/cm<sup>2</sup>程度<sup>(16)</sup>と報告されており,より強いレーザー 光を入射することも可能である.波長 1064 nm の入射光は 赤外線であるため視認できないが,波長 532 nm の変換光は 緑色光として観察できる.周期双晶と同じ形状の単結晶を用 いた場合,変換光は弱く,検出器の限界(0.1 µJ/pulse)以下 であり,周期双晶が擬似位相整合構造として機能したと考え られる.

# 7. おわりに

非強誘電体である四ホウ酸リチウムには作製不可能と考え られてきた擬似位相整合構造を,双晶を利用することで実現 した.四ホウ酸リチウムの双晶界面は結晶成長方向によって 決まる.この特性を利用して結晶中に形成される双晶界面を 制御して100μm間隔の周期双晶を作製し,Nd:YAG レー ザー(波長1064 nm)の第二次高調波発生に成功した.変換 効率の向上と位相整合波長の短波長化のために、より微細な 周期双晶を作製することが今後の課題である.

本稿で紹介した研究の多くは著者が東北大学金属材料研究 所結晶材料化学研究部門宇田研究室在籍時に行い,宇田 聡 教授と藤原航三准教授(現同研究所教授)から懇切丁寧な御指 導と御鞭撻を頂きました.第二高調波発生の測定においては 東北大学多元物質科学研究所 佐藤俊一教授,小澤祐市助 教,中村貴宏助教に御指導を頂きました.

#### 文 献

- (1) T. Kawamura, Y. Shimizu, M. Yoshimura, Y. Fukushima, M. Nishioka, Y. Kaneda, Y. Kitaoka, Y. Mori and T. Sasaki: J.J. Appl. Phys., 45 (2010), 065502.
- (2) K. Wu and C. Chen: Appl. Phys. A, 54(1992), 209-220.
- (3) C. Chen, Z. Xu, D. Deng, J. Zhng and G. Wong: Appl. Phys. Lett., 68(1996), 2930–2932.
- (4) J. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. Pershan: Phys. Rev., **127** (1962), 1918–1939.
- (5) Y. Chen, W. Yan, J. Guo, S. Chen, G. Zhang and Z. Xia: Appl. Phys. Lett., 87 (2005), 212904.
- (6) S. Stivala, A. Busacca, S. Pasquazi, R. Oliveri, R. Morandotti and G. Assanto: Opt. Lett., 35 (2010), 363–365.
- (7) S. Kurimura, M. Harada, K. Muramatsu, M. Ueda, M. Adachi, T. Yamada and T. Ueno: Opt. Lett., 1(2010), 1367–1375.
- (8) J. Krogh-Moe: Acta Cryst., 15(1962), 190–193.
- (9) R. Komatsu, T. Sugawara, K. Sassa, N. Sarukura, Z. Liu, S. Izumida, Y. Segawa, S. Uda, T. Fukuda and K. Yamanouchi: Appl. Phys. Lett., **70**(1997), 3492–3494.
- (10) T. Kwon, J. Ju, H. Kim, D. Kim, J. Cha, J. Kim, S. Yun and M. Cha: Mater. Lett., **30**(1997), 293–297.
- (11) T. Sugawara, R. Komatsu and S. Uda: Solid State Commun., 107(1998), 233–237.
- (12) Y. Burak: J. Crys. Growth, 186(1998), 302–304.
- (13) R. Komatsu T. Sugawara, T. Sugihara and S. Uda: J. J. Appl. Phys., 34(1995), 5467–5470.
- (14) K. Maeda, K. Fujiwara, J. Nozawa, H. Koizumi and S. Uda: J. Cryst. Growth, 331(2011), 78–82.
- (15) K. Maeda, S. Uda, K. Fujiwara, J. Nozawa, H. Koizumi, S. Sato, Y. Kozawa and T. Nakamura: Appl. Phys. Exp., 6 (2013), 015501.
- (16) T. Sugawara, R. Komatsu and S. Uda: Opt. Mater., 13 (1999), 225–229.



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
2012年3月 東北大学大学院理学研究科博士課程修了
2012年4月 東北大学金属材料研究所教育研究支援者
2013年10月 現職
専門分野:半導体と酸化物の結晶成長
◎その場観察法を用いた結晶成長メカニズムの解明と
その応用に関する研究に従事.

前田健作